

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 6 部門第 2 区分
 【発行日】平成30年9月20日 (2018.9.20)

【公表番号】特表2016-511441(P2016-511441A)
 【公表日】平成28年4月14日 (2016.4.14)
 【年通号数】公開・登録公報2016-023
 【出願番号】特願2015-562035(P2015-562035)
 【国際特許分類】

G 0 3 F 7/20 (2006.01)

G 0 2 B 17/06 (2006.01)

【 F I 】

G 0 3 F 7/20 5 0 3

G 0 3 F 7/20 5 2 1

G 0 2 B 17/06

【誤訳訂正書】

【提出日】平成30年8月6日 (2018.8.6)

【誤訳訂正 1】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】全文

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【発明の詳細な説明】

【発明の名称】投影リソグラフィのための照明光学ユニット

【技術分野】

【 0 0 0 1 】

ドイツ特許出願 D E 1 0 2 0 1 3 2 0 4 4 3 1 . 3 の内容が引用によって組み込まれている。

【 0 0 0 2 】

本発明は、結像される物体を配置することができる物体視野を照明光で照明するための投影リソグラフィのための照明光学ユニットに関する。本発明は、更に、そのような照明光学ユニットを有する光学系及び照明系、そのような照明系を有する投影露光装置、そのような投影露光装置を用いて微細構造化又はナノ構造化構成要素を生成するための生成方法、並びにそれによって生成される構成要素に関する。

【背景技術】

【 0 0 0 3 】

冒頭に示したタイプの照明光学ユニットは、W O 2 0 1 0 / 0 4 9 0 7 6 A 2 及び W O 2 0 0 9 / 0 9 5 0 5 2 A 1 から公知である。U S 2 0 1 1 / 0 0 0 1 9 4 7 A 1 及び U S 6 1 9 5 2 0 1 B 1 の各々は、視野ファセットミラー及び瞳ファセットミラーを用いて物体視野を照明するための投影リソグラフィのための照明光学ユニットを記載している。個々のミラーアレイを有する照明光学ユニットは、W O 2 0 0 9 / 1 0 0 8 5 6 A 1 から公知である。

【先行技術文献】

【特許文献】

【 0 0 0 4 】

【特許文献 1】D E 1 0 2 0 1 3 2 0 4 4 3 1 . 3

【特許文献 2】W O 2 0 1 0 / 0 4 9 0 7 6 A 2

【特許文献 3】W O 2 0 0 9 / 0 9 5 0 5 2 A 1

【特許文献 4】U S 2 0 1 1 / 0 0 0 1 9 4 7 A 1

【特許文献 5】US 6 195 201 B1
 【特許文献 6】WO 2009/100 856 A1
 【特許文献 7】EP 1 225 481 A

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

本発明の目的は、結像される物体の照明を柔軟な方式で構成し、かつそれを予め定められた値に十分に適応可能にすることである。

【課題を解決するための手段】

【0006】

本発明により、上述の目的は、当初請求項 1 に指定する特徴を含む照明光学ユニットによって達成される。

[当初請求項 1]

結像される物体 (7) を配置することができる物体視野 (5) を照明光 (16) で照明するための投影リソグラフィのための照明光学ユニット (4 ; 49 ; 61) であって、
 複数の視野ファセット (20) を有する視野ファセットミラー (19) を有し、
 複数の瞳ファセット (28) を有する少なくとも 1 つの瞳ファセットミラー (25) を有し、

前記視野ファセット (20) は、伝達光学ユニット (21 , 25 , 39) によって前記物体視野 (5) 内に結像され、

少なくとも 1 つの瞳ファセットミラー偏光区画 (29 , 30 ; 51 ; 29 , 30 , 63) を有し、これが、前記照明光 (16) の部分ビームを案内するように位置合わせされた、前記視野ファセット (20) のうちの 1 つと、前記瞳ファセット (28) のうちの 1 つとによってそれぞれ形成される照明チャネルに沿う該照明光 (16) の照明ビーム経路 (31) の入射角が、該瞳ファセットミラー偏光区画 (29 , 30 ; 51 ; 29 , 30 , 63) の該瞳ファセット (28) 上の多層反射コーティングのブリュースター角から最大で 20 ° だけ該瞳ファセットミラー偏光区画 (29 , 30 ; 51 ; 29 , 30 , 63) の該瞳ファセット (28) においてずれるように配置され、

少なくとも 1 つの瞳ファセットミラー中立区画 (34 ; 52) を有し、これが、前記照明光 (16) の部分ビームを案内するように位置合わせされた、前記視野ファセット (20) のうちの 1 つと、前記瞳ファセット (28) のうちの 1 つとによってそれぞれ形成される照明チャネルに沿う該照明光 (16) の照明ビーム経路 (37) の入射角が、該瞳ファセットミラー中立区画 (34 ; 52) の該瞳ファセット (28) 上への法線入射から最大で 20 ° だけ該瞳ファセットミラー中立区画 (34 ; 52) の該瞳ファセット (28) においてずれるように配置される、

ことを特徴とする照明光学ユニット (4 ; 49 ; 61) 。

【0007】

本発明により、少なくとも 1 つの偏光区画と少なくとも 1 つの中立区画とへの瞳ファセットミラーの再分割は、物体視野を少なくとも部分的な偏光光及び / 又は非偏光光で交互に照明するオプションを提供することが識別されている。この偏光 / 非偏光照明は、特にレチクルの照明要件に従って選択することができるが、照明光学ユニットの光学構成要素の照明要件に従っても選択することができる。EUV 照明光の偏光は、それぞれ入射を受ける瞳ファセットミラー区画を選択することによって事前選択することができる。瞳ファセットミラー区画のうちの少なくとも 1 つのものに関して、ブリュースター角 (Brewster angle) 及び / 又は法線入射からの入射角の偏角は、最大でも 15 ° 、最大でも 10 ° 、最大でも 5 ° 、最大でも 4 ° 、更に最大でも 3 ° とすることができる。瞳ファセットミラーの中心区画を用いた物体視野の暗視野照明も可能である。

【0008】

当初請求項 2 及び当初請求項 3 に記載の実施形態は、様々な瞳ファセットミラー区画の択一的入射に特に適することが見出されている。特に、視野ファセットミラーの支持体 (

s u p p o r t) は、傾斜可能に具現化することができる。これに代えて又はこれに加えて、照明光学ユニットは、瞳ファセットミラー区画のうちの少なくとも1つに対して、それぞれの瞳ファセットミラー区画を選択するために傾斜可能であり、視野ファセットミラーと瞳ファセットミラーの間の照明ビーム経路に配置された偏向ファセットを有する偏向ファセットミラーを有することができる。これに代えて又はこれに加えて、瞳ファセットミラー区画のうちの少なくとも1つに対して照明ビーム経路を案内するために視野ファセットミラーと瞳ファセットミラーの間に少なくとも1つの更に別の偏向ミラーを設けることができる。

[当初請求項 2]

前記視野ファセットミラー (1 9) は、視野ファセット (2 0) の傾斜位置に基づいて前記瞳ファセットミラー偏光区画 (2 9 , 3 0 ; 5 1 ; 2 9 , 3 0 , 6 3) と前記瞳ファセットミラー中立区画 (3 4 ; 5 2) とが前記照明光 (1 6) によって入射を交互に受けることができるように傾斜させることができる視野ファセット (2 0) を用いて具現化されることを特徴とする当初請求項 1 に記載の照明光学ユニット。

[当初請求項 3]

前記視野ファセットミラー (1 9) は、該視野ファセットミラー (1 9) の傾斜位置に基づいて前記瞳ファセットミラー偏光区画 (2 9 , 3 0 ; 5 1 ; 2 9 , 3 0 , 6 3) と前記瞳ファセットミラー中立区画 (3 4 ; 5 2) とが前記照明光 (1 6) による入射を交互に受けることができるように全体的に傾斜させることができるように具現化されることを特徴とする当初請求項 1 に記載の照明光学ユニット。

【 0 0 0 9 】

一例として、瞳ファセットミラー偏光区画に対する照明ビーム経路の中心主光線の主案内平面から離して配置される偏向ミラーは、当初請求項 4 に記載の主案内平面から少なくとも区画的に外れて案内される照明ビーム経路の案内をもたらすことができる。主案内平面から外れて案内されるこの案内によって障害物を回避することができる。

[当初請求項 4]

前記瞳ファセットミラー中立区画 (3 4) に対する前記照明ビーム経路 (3 7) の中心主光線 (4 0) の案内が、前記少なくとも1つの瞳ファセットミラー偏光区画 (2 9 , 3 0) に対する前記照明ビーム経路 (3 1) の中心主光線 (4 1) の主案内平面 (4 2) を少なくとも区画的に外れて位置し、該主案内平面 (4 2) は、前記視野ファセットミラー (1 9) の反射面の中心 (4 3) と、前記瞳ファセットミラー (2 5) の反射面の中心 (3 2 a) と、中心物体視野点 (4 4) とによって定められることを特徴とする当初請求項 1 から当初請求項 3 のいずれか 1 項に記載の照明光学ユニット。

【 0 0 1 0 】

当初請求項 5 から当初請求項 7 に記載の実施形態は、小型構成を有することができる。

[当初請求項 5]

前記瞳ファセットミラー偏光区画 (2 9 , 3 0 ; 5 1 ; 2 9 , 3 0 , 6 3) と前記瞳ファセットミラー中立区画 (3 4 ; 5 2) は、1つのかつ同じ瞳ファセットミラー (2 5) の区画であることを特徴とする当初請求項 1 から当初請求項 4 のいずれか 1 項に記載の照明光学ユニット。

[当初請求項 6]

前記瞳ファセットミラー偏光区画 (2 9 , 3 0) のうちの少なくとも1つが、前記瞳ファセットミラー中立区画 (3 4) の周りに少なくとも部分円の形態に配置されることを特徴とする当初請求項 1 から当初請求項 5 のいずれか 1 項に記載の照明光学ユニット。

[当初請求項 7]

前記瞳ファセットミラー中立区画 (3 4) のうちの少なくとも1つが、前記瞳ファセットミラー偏光区画 (6 3) の周りに少なくとも部分円の形態に配置されることを特徴とする当初請求項 1 から当初請求項 6 のいずれか 1 項に記載の照明光学ユニット。

【 0 0 1 1 】

当初請求項 8 に記載の変位可能な瞳ファセットミラー区画は、例えば、照明光が、この

区画の背後の照明ビーム経路に配置された更に別の瞳ファセットミラー区画に入射するようにこの経路を開通させることができる。部分的に、入射を受ける瞳ファセットミラー区画の間の切り換え、従って、瞳ファセットミラー上での偏光反射と非偏光反射の間の切り換えが可能である。

〔当初請求項 8〕

前記瞳ファセットミラー偏光区画（ 5 1 ; 6 3 ）又は前記瞳ファセットミラー中立区画（ 3 4 ）は、前記視野ファセットミラー（ 1 9 ）と前記物体視野（ 5 ）の間で前記照明光（ 1 6 ）の前記ビーム経路から変位させることができることを特徴とする当初請求項 1 から当初請求項 7 のいずれか 1 項に記載の照明光学ユニット。

【 0 0 1 2 】

当初請求項 9 に記載の互いに別々の瞳ファセットミラー区画は、互いに対して及び / 又は少なくとも 1 つの瞳ファセットミラー中立区画に対して変位させることができる。

〔当初請求項 9〕

互いに別々である少なくとも 2 つの瞳ファセットミラー偏光区画（ 2 9 , 6 3 ; 3 0 , 6 3 ）を特徴とする当初請求項 1 から当初請求項 8 のいずれか 1 項に記載の照明光学ユニット。

【 0 0 1 3 】

視野ファセットミラーと瞳ファセットミラーの間に配置される偏向ファセットミラーは、物体視野照明を設計する際に更に別の自由度を供給することができる。一例として、偏向ファセット又は瞳ファセットにおいて、特定のターゲット反射角を達成することができる。これらの反射角は、これらのファセットでの反射中のターゲットを定めた偏光効果の採のたけに向けて使用することができる。視野ファセットミラー及び / 又は偏向ファセットミラーは、マルチミラーアレイ又はマイクロミラーアレイとして具現化することができる。特に、マイクロ電気機械システム（MEMS）として具現化することができる。これに代えて、視野ファセットミラー及び / 又は偏向ファセットミラーは、巨視的な視野ファセット又は偏向ファセットを有することができる。ファセットミラーのうちの 1 つがマイクロミラーアレイとして具現化される場合に、ファセットのうちのそれぞれ 1 つは、マイクロな個々のミラー又はマイクロミラーの群によって形成することができる。以下に続く本文では、そのようなマイクロミラー群をファセット個々のミラー群とも記す。視野ファセットミラーのマイクロな個々のミラー群からのそれぞれ 1 つのそのような視野ファセット領域は、偏向ファセットのうちの 1 つ又は中立区画の瞳ファセットのうちの 1 つを照明することができる。原理的に、偏向ファセットのうちのそれぞれ 1 つをマイクロな個々のミラー群によって形成することができる。偏向ファセットは、それぞれの視野ファセット領域の方向から、すなわち、視野ファセットミラーの特定の領域の方向からの照明光を瞳ファセットのうちの正確に 1 つのものに案内するように向けられる。この場合に、視野ファセット領域は、複数又は多数のマイクロな個々のミラーからなる視野ファセットである。偏向ミラーは、異なる傾斜位置の間で、例えば、2 つの自由度に関して傾斜させることができるミラーとして具現化することができる。その結果、例えば、任意的にマイクロミラーアレイとして具現化された視野ファセットミラーの複数の視野ファセット、特に複数のマイクロな個々のミラー群を照明光の適切な案内により、瞳ファセットのうちの正確に 1 つのものに割り当てることができる。偏向ファセットミラーのファセット及び / 又は瞳ファセットミラーのファセットは、固定ファセット、すなわち、異なる傾斜位置の間で傾斜させることができないファセットとして具現化することができる。瞳ファセットミラーの瞳ファセットは、その全部において、傾斜角の僅かな絶対変化を用いて視野ファセット及び / 又は偏向ファセットが到達することができるように配置することができる。瞳ファセットミラーの瞳ファセットは、六方最密充填配置で、直交配置、すなわち、行列で、又は他に回転対称方式で配置することができる。瞳ファセットの配置は、例えば、歪曲効果を補正するために歪曲させることができる。偏向ファセットミラー及び / 又は瞳ファセットミラーは、伝達光学ユニットの結像構成要素とすることができ、例えば、凹及び / 又は凸の偏向ファセット又は瞳ファセットを含むことができる。偏向ファセット又は瞳ファセッ

トは、楕円形又は双曲形の反射面を含むことができる。これに代えて、偏向ファセット又は瞳ファセットは、純粋な偏向ミラーとして具現化することもできる。伝達光学ユニットは、瞳ファセットミラーの後部に配置することができる。視野ファセットミラーは、数百個の視野ファセットを含むことができる。瞳ファセットミラーは、数千個の瞳ファセットを含むことができる。偏向ファセットの個数は、瞳ファセットの個数に等しいとすることができる。視野ファセットの個数は、瞳ファセットの個数に等しいとすることができる。視野ファセット、及び場合によってこれらの視野ファセットを構成するマイクロな個々のミラーは、ビーム形成に向けて曲面又はこれに代えて平面の反射面を有することができる。偏向ファセットミラーの偏向ファセットは、ビーム形成に向けて曲面又はこれに代えて平面の反射面を有することができる。偏向ファセットの個数は、瞳ファセットの個数に少なくとも等しいとすることができる。視野ファセットミラーの視野ファセットの個数、又は視野ファセットを形成するマイクロな個々のミラーの個数は、偏向ファセットの個数よりもかなり大きいとすることができ、例えば10倍大きく、又は更にそれよりも大きいとすることができる。照明光学ユニットは、偏向ファセットミラーが瞳ファセット上に結像されないように構成することができる。照明光学ユニットは、視野ファセットが偏向ファセット上に結像されないように構成することができる。物体視野にわたるか又は物体視野が結像される像視野にわたる強度分布及び/又は照明角度分布を補正するために、経路を折って逸らすことにより、視野ファセットミラー及び/又は偏向ファセットミラーの補正マイクロミラーを使用することができる。視野ファセット、偏向ファセット、及び/又は瞳ファセットの反射面は、物体視野内の結像収差を補正するために、非球面として具現化することができる。この照明光学ユニットを使用することにより、照明光の偏光制御を実現することが可能である。

【0014】

特に、物体構造において回折される照明光の回折角によって予め決定される回折平面が、それぞれの回折平面の法線から45°よりも大きく、20°よりも大きく、15°よりも大きく、10°よりも大きく、又は更に5°よりも大きくずれない照明光の偏光方向との角度を含むような直線偏光照明光によって物体構造が結像される投影リソグラフィのための照明幾何学形状及び結像幾何学形状をもたらすことが可能である。結像を最適化するために、これらの幾何学形状を使用することができる。視野ファセットミラーの視野ファセットは、視野ファセットを物体視野に結像するときの結像効果を少なくとも部分的に補償するために、物体視野の形態からずれることができる。この目的をもたらすために、視野ファセットミラーは、個々の視野ファセット形態タイプが互いに異なる複数の視野ファセット形態タイプを有することができる。瞳ファセットミラーは、照明光の光源が結像される平面の領域に配置することができる。視野ファセット及び/又は瞳ファセットは、更に複数の個々のミラーに再分割することができる。瞳ファセットミラーは、最終的に照明光を案内する照明光学ユニットの構成要素とすることができる。

【0015】

当初請求項10に記載の光学系、当初請求項11に記載の照明系、当初請求項12に記載の投影露光装置、当初請求項13に記載の生成方法、及び当初請求項14に記載の構成要素の利点は、上述の照明光学ユニットを参照して上述したものに対応する。

[当初請求項10]

当初請求項1から当初請求項9のいずれか1項に記載の照明光学ユニットと、露光されるウェーハ(13)を配置することができる像視野(11)内に物体視野(5)を結像するための投影光学ユニット(10)と、を含むことを特徴とする光学系。

[当初請求項11]

当初請求項1から当初請求項9のいずれか1項に記載の照明光学ユニットと、EUV光源(3)と、を含むことを特徴とする照明系。

[当初請求項12]

当初請求項 10 に記載の光学系と、
EUV 光源 (3) と、
を含むことを特徴とする投影露光装置。

[当初請求項 13]

構造化構成要素を生成する方法であって、
感光材料で作られた層が少なくとも部分的に付けられたウェーハ (13) を与える段階
と、
結像される構造を有するレチクル (7) を与える段階と、
当初請求項 12 に記載の投影露光装置 (1) を与える段階と、
前記投影露光装置 (1) を用いて前記レチクル (7) の少なくとも一部を前記ウェーハ
(13) の前記層の領域上に投影する段階と、
を含むことを特徴とする方法。

[当初請求項 14]

当初請求項 13 に記載の方法によって生成された構成要素。

【 0016 】

特に、光学系の投影光学ユニットは、8 倍の縮小率を有するように具現化することができる。それによって特に反射実施形態を有する物体上への照明光の入射角が制限される。照明系の伝達光学ユニット、特に当初請求項 8 に記載のビーム形成ミラーは、照明光学ユニットの射出瞳が、照明ビーム経路内で物体視野の 5 m よりも手前に (more than 5 m in front of the object field in the illumination beam path) 位置するように構成することができる。これに代えて、無限遠における照明光学ユニットの射出瞳の位置、すなわち、テレセントリック照明光学ユニットを達成するか、又は物体視野の背後の照明ビーム経路内、すなわち、下流の投影光学ユニットの結像ビーム経路内の射出瞳の位置を達成することができる。

【 0017 】

投影露光装置の照明光学ユニットは、部分的に光源によって任意的に予め事前偏光された照明光が、特に照明光学ユニットによって生成される直線偏光照明光線がこの事前偏光のうちの可能な最も大きい部分を含むように照明光学ユニット内を案内されるように光源に適応させることができる。それによって投影露光装置の使用光収率が最適化される。

【 0018 】

投影露光装置は、結像される物体を物体視野内に装着するための物体マウントを有することができる。物体マウントは、物体変位方向に沿った物体ホルダの制御式変位のための物体変位ドライブを有することができる。投影露光装置は、ウェーハを像視野内に装着するためのウェーハマウントを有することができる。ウェーハマウントは、物体変位方向に沿ったウェーハマウントの制御式変位のための変位ドライブを有することができる。

【 0019 】

本発明の例示的实施形態を図面に基づいて以下により詳細に説明する。

【図面の簡単な説明】

【 0020 】

【図 1】照明光学ユニットと投影光学ユニットとを含む投影リソグラフィのための投影露光装置を示し、照明光及び結像光のビーム経路を子午断面に再現した非常に概略的な図である。

【図 2】図 1 の線 I I - I I に沿った図 1 に記載の照明光学ユニットの照明ビーム経路を貫く断面図である。

【図 3】瞳ファセットミラー偏光区画と瞳ファセットミラー中立区画とを含む瞳ファセットミラーと、照明ビーム経路に瞳ファセットミラーの上流に投影露光装置の照明光学ユニットの構成要素として配置された偏向ファセットミラーとの図 1 の視線 I I I から見た略上面図である。

【図 4】瞳ファセットミラー中立区画に入射する照明光又は照明放射線を示す図 1 に記

載の照明光学ユニットの瞳ファセットミラー及び偏向ファセットミラーの領域内の拡大区画の図である。

【図 5】瞳ファセットミラーの偏光区画によって反射された照明放射線を示す図 1 に記載の照明光学ユニットの瞳ファセットミラー及び偏向ファセットミラーの領域内の拡大区画の図である。

【図 6】光源の下流に配置された中間フォーカスと照明光学ユニットの物体視野又は照明視野との間の照明ビーム経路を描示する投影露光装置のための照明光学ユニットの更に別の実施形態の図 1 と類似の概略図である。

【図 7】図 6 に記載の実施形態における瞳ファセットミラーの偏光区画の図 6 の視線方向 V I I から見た斜視図である。

【図 8】図 6 及び図 7 に記載の実施形態の偏光区画を図 6 の視線方向 V I I I から見た図である。

【図 9】偏向ファセットミラーと瞳ファセット中立区画及び 2 つの偏光区画を有する瞳ファセットミラーとを図 1 の実施形態の方式で含む図 6 に記載の光学ユニットと同等の照明光学ユニットの更に別の実施形態を瞳ファセットミラー中立区画に入射する照明ビーム経路と共に示す図である。

【図 10】図 9 に記載の照明光学ユニットを照明光が瞳ファセットミラーの偏光区画に入射する照明ビーム経路と共に示す図である。

【図 11】瞳ファセットミラー偏光区画と関連の瞳ファセットミラー中立区画との両方が照明光による入射を受ける互いに対する第 1 の相対位置にある互いに別々の瞳ファセットミラー区画を有する瞳ファセットミラーの更に別の実施形態を示す図 5 と類似の図である。

【図 12】照明光が図 11 に記載の相対位置では非アクティブ状態にあった瞳ファセットミラー偏光区画に入射する別々の瞳ファセットミラー区画の更に別の相対位置にある図 11 に記載の瞳ファセットミラー及び偏向ファセットミラーを示す図である。

【図 13】図 11 及び図 12 に記載の瞳ファセットミラー及び偏向ファセットミラーを図 12 の方向 V I I I から見た図 3 と類似の図である。

【図 14】投影露光装置の走査方向に対して予め決定可能な四重極の向きを有する四重極照明を実現するように具現化された瞳ファセットミラー及び偏向ファセットミラーのピボット可能実施形態の上面図を示す図 3 と類似の図である。

【発明を実施するための形態】

【0021】

図 1 は、マイクロリソグラフィ投影露光装置を子午断面に非常に概略的に示している。

【0022】

放射線源又は光源 3 に加えて、投影露光装置 1 の照明系 2 は、物体平面 6 内に物体視野 5 を露光するための照明光学ユニット 4 を含む。

【0023】

位置関係の説明を簡易化するために、以下では図面内で直交 $x y z$ 座標系を使用する。 x 軸は、図 1 の中に垂直に入り込むように延びている。 y 軸は図 1 の右に延びている。 z 軸は、 $x y$ 平面と垂直に図 1 の下方に延びている。 z 軸は、物体平面 6 と垂直に延びている。

【0024】

その後の選択的な図には、局所直交 $x y z$ 座標系を描示しており、これらの場合に、 x 軸は図 1 に記載の x 軸と平行に延び、 y 軸は、この x 軸と共にそれぞれの光学要素の光学面又は反射面を張る。局所 $x y z$ 座標系の y 軸は、図 1 に記載の広域直交 $x y z$ 座標系の y 軸に対して傾斜している場合がある。

【0025】

物体視野 5 は、1 よりも大きく、例えば、 $13/1$ 、 $10/1$ 、又は $3/1$ に等しい x/y アスペクト比を有する矩形実施形態又は弓形実施形態を有することができる。照明光学ユニット 4 は、物体視野 5 に配置され、微細構造半導体構成要素又はナノ構造半導体構

成要素を生成するために投影露光装置 1 によって投影される構造を支持する反射レチクル 7 を露光するのに使用される。レチクル 7 は、物体変位ドライブ 9 によって駆動される物体マウント又はレチクルマウント 8 によって支持され、y 方向に変位させることができる。図 1 に非常に概略的に描示する投影光学ユニット 10 は、物体視野 5 を像平面 12 の像視野 11 内に結像するように機能する。投影露光装置 1 の光学構成要素の全体的に、照明光学ユニット 4 と投影光学ユニット 10 とが光学系を形成する。レチクル 7 上の構造は、像平面 12 の像視野 11 の領域に配置されたウェーハ 13 の感光層上に結像される。ウェーハ 13 は、投影露光中にウェーハ変位ドライブ 15 を用いてレチクルマウント 8 と同期した駆動方式で y 方向に変位したウェーハマウント 14 によって支持される。実際には、レチクル 7 及びウェーハ 13 は、物体視野 5 及び像視野 11 よりも有意に大きい。

【0026】

投影露光装置 1 の作動中に、レチクル 7 とウェーハ 13 とは y 方向に同期して走査される。投影光学ユニット 10 の線形倍率に基づいて、ウェーハ 13 に対して反対の方向のレチクル 7 の走査も可能である。

【0027】

放射線源 3 は、5 nm と 30 nm の間の範囲の放出使用放射線を有する EUV 放射線源である。この場合に、EUV 放射線源は、プラズマ光源、例えば、GDPP (ガス放電生成プラズマ) 光源又は LPP (レーザ生成プラズマ) 光源とすることができる。他の EUV 放射線源、例えば、シンクロトロン又は自由電子レーザ (FEL) に基づくものも可能である。

【0028】

放射線源 3 から発し、図 1 に一点鎖線の主光線に示す EUV 放射線ビーム 16 が、コレクター 17 によってフォーカスされる。一例として、適切なコレクターが EP 1 2 2 5 4 8 1 A から公知である。以下に続く本文では、EUV 放射線ビーム 16 を使用放射線、照明光、又は結像光とも記す。

【0029】

コレクター 17 の後に、EUV 放射線ビーム 16 は中間フォーカス 18 を通って伝播し、その後に、視野ファセットミラー 19 上に入射する。視野ファセットミラー 19 の前には、使用 EUV 放射線ビーム 16 を投影露光に使用することができず、放射線源 3 による他の放出波長成分から分離するスペクトルフィルタを配置することができる。スペクトルフィルタは描示しなかった。

【0030】

視野ファセットミラー 19 は、照明光学ユニット 4 の物体平面 6 と光学的に共役な平面に配置される。視野ファセットミラー 19 は複数の視野ファセット 20 を含み、そのうちの一部のものだけを図 1 に概略的に描示している。視野ファセットミラー 19 は、数百個の視野ファセット 20 を有することができる。視野ファセットミラー 19 の視野ファセット 20 は、物体視野 5 の x / y アスペクト比にほぼ一致する x / y アスペクト比を有する。従って、視野ファセット 20 は、1 よりも大きい x / y アスペクト比を有する。視野ファセット 20 の長いファセット辺は x 方向に延びている。視野ファセット 20 の短いファセット辺は y 方向 (走査方向) に延びている。

【0031】

視野ファセットミラー 19 は、マイクロ電気機械システム (MEMS) として具現化することができる。この場合に、視野ファセットミラー 19 は、アレイ内に行と列とで行列状で配置された複数の視野ファセット個々のミラーを含み、図面にはこれらのミラーを描示していない。そのような個々のミラー再分割に関する例は、US 2011 / 0001947 A1 に示されている。ファセット個々のミラーは、正方形又は矩形の反射面を有することができる、又は例えば菱形又は平行四辺形の形態にある異なる縁部を有する反射面を有することができる。ファセット個々のミラーの縁部形状は、テッセレーションの理論から公知のものに対応することができる。特に、US 2011 / 0001947 A1 及びそこに引用されている参考文献から公知のテッセレーションを使用することができる。

。

【 0 0 3 2 】

ファセット個々のミラーは、平面反射面又は曲面、例えば、凹反射面を有することができる。ファセット個々のミラーは、各々アクチュエータに接続され、それぞれのファセット個々のミラーの反射平面内で互いに対して垂直な2つの軸の周りに傾斜可能であるように設計される。これらのアクチュエータは、この図には描示していない方式で中央制御デバイス24（図1を参照されたい）に信号接続され、ファセット個々のミラーの個々の傾斜に向けてこの中央制御デバイス24によってアクチュエータを起動することができる。

【 0 0 3 3 】

全体的に、視野ファセットミラー19は約100 000個のファセット個々のミラーを有する。ファセット個々のミラーのサイズに基づいて、視野ファセットミラー19は、例えば、1000個、5000個、7000個、又は他に数十万個、例えば、500 000個のファセット個々のミラーを有することができる。これに代えて、ファセット個々のミラーの個数は、有意に少ないとすることができる。ファセット個々のミラーは群に組み合わされ、ファセット個々のミラー群のうちのそれぞれ1つが視野ファセット20のうちの1つを形成する。そのような群組合せに関する例は、同じくUS 2011/0001947 A1によって示されている。ファセット個々のミラーは、EUV使用光16のそれぞれの入射角及び波長に対して最適化された高反射多層を有することができる。正方形形態に対する代替として、視野ファセット個々のミラーは、例えば、値1から50%よりも大きくずれたアスペクト比を有する反射面を有することができる。値1からずれたアスペクト比を有するそのような視野ファセット個々のミラーは、照明光16のビーム方向の視野ファセット個々のミラーの投影が、値1の領域内のアスペクト比を有するように配置することができる。

【 0 0 3 4 】

視野ファセット20は、照明光16の部分ビームを偏向ファセットミラー21上に反射する。

【 0 0 3 5 】

次いで、偏向ファセットミラー21の偏向ファセット22は、照明光16の部分ビームを瞳ファセットミラー25上に反射する。

【 0 0 3 6 】

偏向ファセット22は、瞳ファセットミラー25の周りに部分リング、すなわち、半円として配置された偏向ミラー支持体26上に配置される。これを図2に描示している。偏向ミラー支持体26によって予め決定される偏向ファセットミラー21のミラー支持面は、偏向ミラー支持体26のリング平面27に対して角度付けされ、リング形偏向ミラー支持体26を円錐（錐、cone）区画として取り囲む。リング平面27は、図2の断面平面とほぼ一致する（図1の線II-IIを参照されたい）。更に、リング平面27は、瞳ファセットミラー25が配置された瞳平面とほぼ一致する。偏向ファセット22は、偏向ミラー支持体26上に配置され、この場合に、これらの偏向ファセットの反射面は、好ましくは、偏向ミラー支持体26のミラー支持面の局所的な向きと平行である。偏向ミラー支持体26の局所ミラー支持面に対する偏向ファセット22の反射面の傾斜した向きも可能である。アクチュエータ23を用いて、偏向ファセット22の反射面の向きを2つの軸の周りに傾斜させることができる。

【 0 0 3 7 】

瞳ファセットミラー25は、投影レンズ10の瞳平面と光学的に共役な領域に位置する。同時に、瞳ファセットミラー25は、光源3又は中間フォーカス18が結像される平面の領域に配置される。

【 0 0 3 8 】

瞳ファセットミラー25は、複数の瞳ファセット28を有し、図3にそのうちの一部を点として略描示している。図3には、偏向ファセットミラー21を通して瞳ファセットミラー25上に入射する照明光16のいくつかの部分ビームを矢印で描示している。この図

では明瞭性を改善するために、偏向ファセットミラー 21 は、それ自体を図 1 に記載の図から明らかなようにその裏側ではなくその反射側が閲覧者に対面するように描示している。偏向ファセット 22 の各々は、視野ファセット 20 によって反射された照明光 16 を正確に 1 つの瞳ファセット 28 にわたって案内する。アクチュエータ 23 を用いた偏向ファセット 22 の向きの切り換えにより、異なる視野ファセット 20 からの光は、1 つの同じ瞳ファセット 28 にわたって案内することができる。

【0039】

視野ファセットミラー 19 の視野ファセット 20 は、偏向ファセットミラー 21 と瞳ファセットミラー 25 とによって形成されるか、又は視野ファセットミラー 19 と物体視野 5 との間、特に瞳ファセットミラー 25 と物体視野 5 との間に更に別の構成要素を含むかのいずれかである伝達光学ユニットを用いて物体視野 5 に結像される。視野ファセット 20 が照明光 16 によって完全に照明されると仮定すると、視野ファセット 20 の各々を全体の物体視野 5 に結像することができる。視野ファセット 20 を複数の個々のミラーから構成することができる。瞳ファセット 28 を複数の個々のミラーから構成することができる。

【0040】

視野ファセットミラー 19 の視野ファセット 20、偏向ファセット 22、及び瞳ファセットミラー 25 の瞳ファセット 28 は、使用光 16 の波長に適合された多層反射コーティングを有する。瞳ファセット 28 は、丸形、六角形、又は矩形の実施形態を有することができ、それに関連付けられた対称性に則して配置することができる。

【0041】

瞳ファセットミラー 25 は、百超から数千個 (more than hundred to several thousand) の瞳ファセット 28、例えば、10 000 個の瞳ファセット 28 を有する。視野ファセットミラー 19 の視野ファセット 20 の個数は、瞳ファセットミラー 25 の瞳ファセット 28 の個数に等しいか又はそれ未満とすることができる。偏向ファセット 22 の個数は、瞳ファセット 28 の個数に対応し、特に、正確に等しい。

【0042】

視野ファセット 20 及び瞳ファセット 28 の各々は、この図にはこれ以上詳細には描示していないファセットミラー支持体上に配置される。例示的实施形態において、ファセットミラー 19 のファセットミラー支持体は平面実施形態を有する。これに代えて、ファセットミラー支持体は、曲面実施形態、例えば、球面曲面実施形態を有することができる。

【0043】

瞳ファセットミラー 25 は、各々が横切頭円錐区画 (lateral frustum sections) として具現化された 2 つの外側偏光区画 29、30 を有する。瞳ファセットミラー偏光区画 29、30 は、これらの瞳ファセットミラー偏光区画 29、30 の瞳ファセット 28 における照明ビーム経路 31 の入射角が、瞳ファセットミラー偏光区画 29、30 の瞳ファセット 28 上の多層反射コーティングのプリユースター角から最大でも 20° しかずれないように配置される。照明光 16 の照明ビーム経路 31 は、各々が視野ファセット 20 のうちの 1 つと瞳ファセット 28 のうちの 1 つとによって形成される照明チャンネルに沿って延びている。各々照明チャンネルのうちの 1 つを構成するこれらのファセット 20、28 は、照明光 16 の部分ビームを案内するために位置合わせする。

【0044】

瞳ファセットミラー 25 のうちで図 3 に記載の平面図内で部分リング形状を有する偏光区画 29 は、瞳平面 27 と視野ファセットミラー 19 の間のビーム経路に位置する。偏光区画 29 の切頭円錐の半区画の円錐先端 (A cone tip of the section of half a frustum of the polarization section 29) は、瞳ファセットミラー 25 のミラー支持体の中心 32a を通る法線上に位置する。この場合に、瞳ファセットミラー 25 の中心 32a は、照明光学ユニット 4 の瞳平面 27 上に投影される瞳ファセットミラー支持体の円周輪郭の中心と

して定められる。この瞳平面 27 を図 7 の斜視図に描示している。

【0045】

瞳ファセット 28 に対する支持体設計によって予め決定される偏光区画 29 のミラー支持面は、凸設計を有する。切頭円錐形の偏光区画 29 がセグメントを形成する円錐の開き角の半分は約 45° である。偏光区画のこの切頭円錐区画の方位角は約 180° である。この方位角は、偏光区画 29 の末端縁部 33 と末端縁部 33 の間に位置する。これらの末端縁部 33 は、偏光区画 29 の切頭円錐区画の真っ直ぐな横線に沿って延びている。

【0046】

第 2 の偏光区画 30 は、図 3 に記載の上面図で見た場合に 2 つの偏光区画 29、30 が瞳ファセットミラー 28 の中央瞳ファセットミラー中立区画 34 の周りにリングを形成するように、上述の偏光区画 29 の部分リング形状に対する相補部を構成する。第 2 の偏光区画 30 は、瞳平面 27 と物体平面 6 の間の照明光 16 の照明ビーム経路に位置する。瞳ファセットミラー 25 の第 2 の偏光区画 30 も同じく部分的な切頭円錐形状を有し、凸の偏光区画 29 とは対照的に、第 2 の偏光区画 30 のミラー支持面は、凹実施形態を有する。第 2 の偏光区画 30 のこの凹切頭円錐形状の円錐先端も、瞳ファセットミラー 25 の中心 32a を通る瞳平面 27 の法線上に位置する。図 3 に記載の上面図では、この第 2 の偏光区画 30 の末端縁部 35 は、第 1 の偏光区画 29 の末端縁部 33 と事実上一致する。瞳平面 27 上の投影において見られるように、これらの末端縁部 33、35 は、偏光区画 29、30 の間の接合部の区切ることができる。

【0047】

第 2 の偏光区画 30 の切頭円錐区画の開き角の半分は、第 1 の偏光区画 29 と同じサイズを有し、すなわち、同じく約 45° である。第 2 の偏光区画 30 の切頭円錐区画も、約 180° の方位角にわたって スイープする (sweep)。

【0048】

二重切頭円錐を区画的に有する 2 つの偏光区画 29、30 のこの実施形態は、瞳ファセットミラー 25 の偏光区画 29、30 が、偏向ファセットミラー 21 の各外周角位置から瞳ファセットミラー 25 の中心 32a に向けて半径方向に見た場合に直線で延びて、瞳平面 27 に対して同じ角度で傾斜する線を形成することを確実にする。

【0049】

図 3 から図 5 に例示的な方式で描示するように、瞳平面 27 上への投影において、照明光 16 が偏向ファセット 22 から瞳ファセット 28 に瞳ファセットミラー 25 の中心 32a に関して良い近似で半径方向に案内されると仮定すると、偏光区画 29、30 の瞳ファセット 28 における照明光 16 の全ての部分ビームは、良い近似で同じ入射角 θ_p で偏向される。一例として、この入射角は、最大でも 20° 、又は最大でも 15° 、最大でも 10° 、最大でも 5° 、又は最大でも 3° の偏角しか伴わずに約 43° のブリュースター入射角の前後に並ぶ。この場合に、瞳ファセットミラー 25 の偏光区画 29、30 内で、瞳ファセット 28 及び瞳ファセットミラー 25 は、偏光子として機能する。それによって照明光 16 が瞳ファセットミラー 25 の偏光区画 29、30 に案内される起点になる偏向ファセットミラー 21 上の場所に基づいて、それぞれの入射平面に対して垂直な適正直線偏光を有する照明光 16 の部分ビームがもたらされる。

【0050】

図 3 に偏光矢印 36 に示すように、瞳平面 27 上への投影において、得られる偏光方向は、偏向ファセットミラー 21 の半円形状に対してタンジェンシャル方向に延びている。従って、xy 平面内で全ての直線偏光方向を生成することができるので、図 3 の瞳ファセットミラー 25 上の対応する偏光矢印 36 によって示すように、偏光区画 29、30 上での反射によってタンジェンシャル偏光を有する照明瞳を生成することができる。

【0051】

瞳ファセットミラー 25 のミラー支持体上で中心に配置された瞳ファセットミラー 25 の中立区画 34 は、照明チャネルに沿う照明光 16 の照明ビーム経路 37 の入射角 θ_N が、中立区画 34 の瞳ファセット 28 において法線入射から最大でも 20° しかずれないよ

うに配置される。照明光学ユニット 4 の偏向ミラー 4 5 にわたるビーム偏向の幾何学形状に基づいて、照明チャネルに沿う照明光 1 6 の照明ビーム経路の入射角の偏角は、瞳ファセットミラー 2 5 の中立区画 3 4 の瞳ファセット 2 8 で反射される時に、最大でも 1 5 °、最大でも 1 0 °、最大でも 5 °、又は他に最大でも 3 °とすることができる。

【 0 0 5 2 】

瞳ファセットミラー 2 5 の中立区画 3 4 は、ほぼ瞳平面 2 7 内で延びている。偏光区画 2 9、3 0 の各々は、中立区画 3 4 上で外縁 3 8 によって半円形形状で形成される。

【 0 0 5 3 】

照明光 1 6 は、照明ビーム経路 3 1 内で瞳ファセットミラー 2 5 の偏光区画 2 9、3 0 によってビーム形成ミラー 3 9 に案内される。ビーム形成ミラー 3 9 は、照明光学ユニット 4 の射出瞳を照明ビーム経路内で物体視野 5 の 5 m よりも手前に (more than 5 m in front of the object field 5 in the illumination beam path) 位置付ける。これに代えて、無限遠における照明光学ユニット 4 の射出瞳の位置を達成することができ、すなわち、照明光学ユニットのテレセントリック性を達成するか、又は物体視野 5 の背後の照明ビーム経路、すなわち、下流の投影光学ユニット 1 0 の結像ビーム経路内の射出瞳の位置を達成することができる。偏光区画 2 9、3 0 の瞳ファセット 2 8 は、照明ビーム経路 3 1 を通じたビーム形成ミラー 3 9 上への直接入射をもたらす。

【 0 0 5 4 】

瞳ファセットミラー 2 5 の中立区画 3 4 に対する照明ビーム経路 3 7 の中心主光線 4 0 は、瞳ファセットミラー 2 5 の偏光区画 2 9、3 0 に対する照明ビーム経路 3 1 の中心主光線 4 1 の主案内平面 4 2 内に案内されない。図 1 の作図面と一致する主案内平面 4 2 は、視野ファセットミラー 1 9 の反射面の中心 4 3 と、瞳ファセットミラー 2 5 の反射面の中心 3 2 a と、中心物体視野点 4 4 とによって定められる。

【 0 0 5 5 】

中立区画 3 4 に対する照明ビーム経路 3 7 内の照明光 1 6 は、視野ファセットミラー 1 9 と瞳ファセットミラー 2 5 の中立区画 3 4 との間でビーム経路 3 7 内の偏向ミラー 4 5 を通して案内される。偏向ミラー 4 5 は、傾斜可能個々のミラーとして具現化することができるが、これは必須ではない。瞳ファセットミラー 2 5 の中立区画 3 4 上での反射の後に、照明ビーム経路 3 7 の中心主光線は、2 つの偏光区画 2 9、3 0 に対する照明ビーム経路 3 1 の中心主光線 4 1 と一致する。次いで、2 つの照明ビーム経路 3 1、3 7 は、図 1 に一点鎖線に示す同じ経路 4 6 に沿って延びる。

【 0 0 5 6 】

2 つの偏光区画 2 9、3 0 と中立区画 3 4 とは、1 つの同じ瞳ファセットミラー 2 5 の区画である。これに代えて、区画 2 9、3 0、及び 3 4 を互いに別々の特に互いに別々に装着される構成要素として具現化することができる。

【 0 0 5 7 】

中間フォーカス 1 8 は、各々視野ファセット 2 0 を用いて、更に偏向ファセット 2 2 がビーム経路に設けられる場合はそれを用いてビーム 1 6 によって照明される瞳ファセット 2 8 に結像される。照明される瞳ファセット 2 8 の各々の上には、中間フォーカス 1 8 の像を提供する。この結像は、完全である必要はない。

【 0 0 5 8 】

照明チャネルは、それぞれ視野ファセット 2 0 のうちの 1 つにより、又は視野ファセット 2 0 を形成する視野ファセット個々のミラー群により、偏向ファセット 2 2 がビーム経路に配置される場合はこれらの偏向ファセット 2 2 のうちの 1 つにより、更に瞳ファセット 2 8 のうちの 1 つによって形成される。視野ファセットミラー 1 9 の個々のミラーのうちの何個がそれぞれの照明チャネルに寄与するかに基づいて、この中間フォーカス像を各々視野ファセット個々のミラーのうちの 1 つにわたって照明光 1 6 を案内することに起因して、それぞれの瞳ファセット 2 8 上に達成される複数の中間フォーカス像の重ね合わせ像として生成することができる。この場合に、中間フォーカス像は、正確にそれぞれの照

明チャンネルの瞳ファセット 28 上に生成する必要はない。特に中間フォーカス像が瞳ファセット 28 上に完全に位置するように、それぞれの瞳ファセット 28 を中間フォーカス像の領域に置くだけで十分である。同様に、例えば、照明チャンネルの照明光エネルギーのうちの 95% が、それぞれの瞳ファセット 28 上に収まり、すなわち、中間フォーカス像の僅かな部分が、瞳ファセット 28 上に位置しない場合でも十分とすることができる。

【0059】

視野ファセット 20 は、偏向ファセット 22 と瞳ファセット 28 を用いて、更に瞳ファセットミラー 25 の下流のビーム 16 のビーム経路に配置されたビーム形成ミラー 39 を用いて、物体視野 5 内で互いに重ねて結像される。照明光 16 が照明ビーム経路 31 に沿って案内されるか、又は照明ビーム経路 47 に沿って案内されるかに基づいて、偏向ファセットミラー 21 の偏向ファセット 22 及び偏向ミラー 45 がこの重ね合わせ結像に寄与することも可能である。

【0060】

レチクル 7 における照明光 16 の主光線 CR と物体平面 6 の法線との間の主光線角度は、例えば、 6° であり、 3° と 8° の間の範囲に収まることができる。物体視野 5 を照明するビーム 16 の合計開き角は、反射レチクル 7 がウェーハ上に均一方式で結像されるように、この主光線角度に適合される。レチクル 7 によって反射されたビーム経路 47 は、レチクル 7 上に入射する照明光 16 のビーム経路 48 を完全に外れて位置する（図 1 及び図 2 を参照されたい）。

【0061】

図 2 は、偏向ミラー支持体 26、並びに照明ビーム経路 37 及び 48 が瞳ファセットミラー 25 に対して可能な限り近くに配置されるように、偏向ファセットミラー 21 が、主案内平面に関して非対称に曲げられて配置され、瞳ファセットミラー 25 の周りの 180° の弧の形態にある配置を明らかにしている。

【0062】

従って、偏向ファセットミラー 21 は、 $y-z$ 平面と平行な平面に関して鏡面对称に配置されず、 z 軸と平行な軸の周りに回転されて配置される。

【0063】

視野ファセット 20、偏向ファセット 22、又は瞳ファセット 28 のどれが結像伝達光学ユニットの構成要素であるかに基づいて、視野ファセット 20、偏向ファセット 22、及び / 又は瞳ファセット 28 は、結像効果を有し、すなわち、特に凹設計を有するか、純粋な偏向ミラー、平面ミラー、又は平面ファセットとして具現化されるかのいずれかである。視野ファセット 20、偏向ファセット 22、及び / 又は瞳ファセット 28 は、照明光学ユニット 4 の収差を補正するための補正非球面を有することができる。

【0064】

偏光区画 29、30 の瞳ファセット 28 は、その上での反射の後に瞳ファセット 28 上のそれぞれの照明光部分ビームの入射平面に対して s 偏光状態にある照明光 16 をもたらず偏光要素として機能する。図 1 には、この s 偏光を照明光 16 の部分ビーム上に点に示している。従って、図 1 の作図面内で伝播する照明ビーム経路 31 のビームは、瞳ファセット 28 での反射の後に作図面に対して垂直な偏光状態にある。

【0065】

偏向ファセット 22 の個数は、視野ファセット 20 の個数と少なくとも同じ程度に大きい。図 1 に記載の実施形態において、実際の偏向ファセット 22 の個数は、視野ファセット 20 の個数よりもかなり多く、特に 10 倍大きい又は更にそれよりも大きいとすることができる。照明光学ユニット 4 は、視野ファセット 20 が偏向ファセット 22 上に結像されず、偏向ファセット 22 が瞳ファセット 28 上に結像されないように具現化される。

【0066】

図 4 は、中立区画 34 上に入射する照明ビーム経路 37 を示しており、図 5 は、中立区画 34 の瞳ファセット 28 によって反射された照明ビーム経路 37 を示している。更に、図 4 及び図 5 には、それぞれ照明ビーム経路 31 を区画的に描示しており、図 5 は、偏光

区画 29、30 によって反射された照明光束経路 31 の一部も描示している。

【0067】

照明光学ユニット 4 の 1 つの変形では、第 1 に偏向ファセットミラー 21 及び第 2 に瞳ファセットミラー 25 は、瞳ファセットミラー 25 の中心 32 a を通って瞳ファセットミラー 25 と物体視野 5 の間の照明光 16 の光軸に沿って延びる共通のピボット軸 48 a の周りにピボット可能である。一例として、偏向ファセットミラー 21 及び瞳ファセットミラー 25 は、ピボット軸 48 a の周りに $\pm 45^\circ$ の範囲のピボット角度だけ回転させることができる。このピボット回転は、共通制御又は他に互いに独立した制御によって達成することができる。ピボット回転目的のために、偏向ファセットミラー 21 及び瞳ファセットミラー 25 は、共通のピボットドライブに機能的に接続されるか、又は各々これらのミラー独自のピボットドライブに機能的に接続されるかのいずれかであり、このピボットドライブは、図 1 の 48 b に非常に概略的に描示している。ピボットドライブ 48 b は、ステッパモータとすることができる。

【0068】

更に、照明光学ユニット 4 の実施形態のこの変形では、視野ファセットミラー 19 は、視野ファセットミラー支持体の中心を通って延びて視野ファセットミラー 19 の主反射面に対して垂直であるピボット軸 48 c の周りにピボット可能である。ピボット軸 48 c の周りの視野ファセットミラー 19 のピボット機能は、 $\pm 90^\circ$ の範囲に収まることができる。ピボット回転目的のために、視野ファセットミラーは、同じく図 1 に非常に概略的に示すピボットドライブ 48 d への機能的接続を有する。ピボットドライブ 48 d も同じくステッパモータとすることができる。

【0069】

ピボットドライブ 48 b 及び 48 d は、中央制御デバイス 24 への信号接続を有する。

【0070】

ピボット回転中に、視野ファセットミラー 19 が、偏向ファセットミラー 21 及び瞳ファセットミラー 25 の共通ピボット回転と比較して 2 倍のピボット角度サイズだけピボット回転されるように、ピボットドライブ 48 b、48 d を作動させることができる。

【0071】

一例として、全体的にピボット可能なファセットミラー 19、21、25 を有する照明光学ユニットの実施形態は、例えば、物体視野 5 の照明の正確に 1 つの直線偏光方向だけ又は正確に 2 つの直線偏光方向が予め決定される場合に使用され、この場合に、これらの直線偏光方向の向きは、ピボット軸 48 a 及び 48 c の周りのそれぞれのピボット角度に依存して予め決定される。それによって一例として、物体視野 5 の照明に対して正確に 1 つの偏光方向が予め決定される場合に、又は物体視野 6 の照明に対して物体平面 6 内で互いに対して垂直な正確に 2 つの偏光方向が予め決定される場合に、視野ファセットミラー 19 の視野ファセット 20 を密充填方式で配置することができる照明幾何学形状がもたらされる。このピボット可能実施形態に対しては、尚も図 14 に基づいて下記でより詳細に説明する。

【0072】

ピボット可能偏向ファセットミラー 21 及びピボット可能瞳ファセットミラー 25 を有する変形では、視野ファセットミラー 19 がマイクロミラーで生成された視野ファセット 20 を有する場合に、視野ファセットミラー 19 のピボット機能を割愛することができる。この場合に、視野ファセット 20 をこの場合に適合されたマイクロミラーの群割り当てを用いて、偏向ファセットミラー 21 及び瞳ファセットミラー 25 のそれぞれのピボット位置に従って位置合わせすることができる。

【0073】

投影露光装置 1 内で照明光学ユニット 4 の代わりに使用することができる照明光学ユニットの更に別の実施形態 49 を図 6 に基づいて以下に説明する。図 1 から図 5 を参照して上述したものに対応する構成要素及び機能は同じ参照符号を伴い、これらに対して下記で再度詳細に解説することはしない。図 6 は、中間フォーカス 18 と物体視野 5 の間の照明

光 1 6 のビーム経路を示している。

【 0 0 7 4 】

図 6 に記載の実施形態において、視野ファセットミラー 1 9 の傾斜位置に基づいて、照明光 1 6 を図 6 に照明ビーム経路 5 0 に示すように、偏向ファセットミラー 2 1 を通して瞳ファセットミラー 2 5 の偏光区画 5 1 に印加するか、又は瞳ファセットミラー 2 5 の中立区画 5 2 に直接印加するかのいずれかを任意的に行うことができるように、視野ファセットミラー 1 9 全体が傾斜可能に具現化される。図 6 では、偏向ファセットミラー 2 1 上に入射し、次いで、偏光区画 5 1 に入射するための視野ファセットミラー 1 9 の傾斜位置を実線で描示している。瞳ファセットミラー 2 5 の中立区画 5 2 を作動させるためのこの場合 1 9 ' で表す視野ファセットミラーの対応する傾斜位置は破線で描示している。視野ファセットミラー 1 9 を傾斜させる目的のために、視野ファセットミラー 1 9 は、図 6 に略示する傾斜アクチュエータ 5 3 に接続される。

【 0 0 7 5 】

瞳ファセットミラー 2 5 の偏光区画 5 1 は、図 6 に同じく略示する変位アクチュエータ 5 4 に接続される。変位アクチュエータ 5 4 を使用すると、偏光区画 5 1 が照明光 1 6 を偏向ファセットミラー 2 1 から物体視野 5 に案内する図 6 に描示する反射位置から、偏光区画 5 1 が照明光 1 6 のビーム経路に完全に変位された無効位置まで偏光区画 5 1 を移動することができる。偏光区画 5 1 のこの無効位置では、照明光 1 6 を視野ファセットミラー 1 9 から物体視野 5 に反射するのに瞳ファセットミラー 2 5 の中立区画 5 2 が利用可能である。

【 0 0 7 6 】

図 6 に記載の実施形態における瞳ファセットミラー 2 5 の偏光区画 5 1 のミラー支持体は、横二重円錐区画の形状を有する。

【 0 0 7 7 】

第 1 の横円錐区画 (l a t e r a l c o n e s e c t i o n) 5 5 は、瞳平面 2 7 と物体平面 6 の間の照明光 1 6 のビーム経路に位置する。第 1 の横円錐区画 5 5 のミラー支持面は、凹半円錐を形成し、同時に二重円錐の先端を構成するその円錐先端 5 6 は瞳平面 2 7 に位置する。横円錐区画 5 5 が一区画を形成する円錐の開き角の半分 は約 4 5 ° である。横円錐区画 5 5 の方位角 は 1 8 0 ° である。この方位角 は、横円錐区画 5 5 の末端縁部 5 7 の間に位置する。これらの末端縁部 5 7 は、横円錐区画 5 5 の真っ直ぐな横線に沿って延びている。

【 0 0 7 8 】

照明光学ユニット 4 9 の瞳ファセットミラー 2 5 の二重円錐区画形態は、上述の横円錐区画 5 5 の円錐先端 5 6 と一致する円錐先端 5 6 を有する更に別の横円錐区画 5 8 によって相補される。第 2 の横円錐区画 5 8 の末端縁部 5 9 は、第 1 の横円錐区画 5 5 の末端縁部 5 7 の円錐先端 5 6 を通る延長部を構成する。末端縁部 5 7 及び 5 9 は、横円錐区画 5 5 、 5 8 の間の接合部 6 0 の区切る (図 8 を参照されたい) 。

【 0 0 7 9 】

第 2 の横円錐区画 5 8 のミラー支持面は、凸弧を有する。第 2 の横円錐区画 5 8 の開き角の半分 は、第 1 の横円錐区画 5 5 の開き角の半分 と正確に同じサイズを有する。横円錐区画 5 8 も、約 1 8 0 ° の方位角 にわたって スイープする (s w e e p) 。

【 0 0 8 0 】

2 つの横円錐区画 5 5 、 5 8 の二重円錐配置、及びそれに関連付けられた半円形偏向ファセットミラー 2 1 の配置は、偏向ファセットミラー 2 1 のいかなる外周角から観察した場合にも、瞳ファセットミラー 2 5 が、瞳平面 2 7 に対して同じ角度 で傾斜した直線を形成するようなものである。言い換えれば、偏向ファセットミラー 2 1 とレンチクル 7 の間の光軸 (図 6 では C R) を通る図 6 と類似の各作図面では、偏向ファセットミラー 2 1 と瞳ファセットミラー 2 5 とにおける断面図形が直線である。

【 0 0 8 1 】

照明光 1 6 が、偏向ファセット 2 2 から瞳ファセット 2 8 まで瞳平面 2 7 上への投影に

において瞳ファセットミラー 25 の中心 32a に関して良い近似で半径方向に案内されると仮定すると、照明光 16 の全ての部分ビームは、瞳ファセット 28 において同じ入射角で偏向される。ここでもまた、瞳ファセットミラー 25 の瞳ファセット 28 が、相応に偏向される照明光 16 に対する偏光子として機能するように、この入射角は、最大でも 20°、又は最大でも 15°、最大でも 10°、最大でも 5°、又は最大でも 3° の偏角しか伴わずに約 43° のブリュースター入射角付近に位置する。それによって偏向ファセットミラー 21 のどの場所から光が瞳ファセットミラー 25 に案内されるかに基づいて、適切な直線偏光を有する照明光の部分ビームがもたらされる。

【0082】

瞳平面 27 上への投影において、得られる偏光方向は、偏向ファセットミラー 21 の半円形形態に対してタンジェンシャル方向に延びる。従って、全ての直線偏光方向を生成することができるので、タンジェンシャル偏光を有する照明瞳を生成することができる。

【0083】

瞳ファセットミラー 25 の中立区画 52 は、図 6 の作図面と垂直に、すなわち、xy 平面に配置された平面ミラー支持面を有する。

【0084】

偏光区画 51 及び中立区画 52 は、図 6 に記載の実施形態では互いに別々の瞳ファセットミラー 25 の 2 つの区画を構成する。

【0085】

全体的に傾斜させることができる視野ファセットミラー 19 に対する代替として、図 6 に記載の実施形態は、偏向視野ファセット 21 への照明ビーム経路 50 と中立区画 52 への照明ビーム経路の間の切り換えが、各々視野ファセットミラー 19 の個々の視野ファセット 20 を傾斜させることによって引き起こされるように具現化することができる。この場合に、視野ファセットミラー 19 は、照明光 16 が、視野ファセットの傾斜位置に基づいて、交互に瞳ファセットミラー 25 の偏光区画 51 又は中立区画 52 のいずれかに入射することができるように、傾斜可能視野ファセット 20 を用いて具現化される。

【0086】

図 9 及び図 10 は、図 1 から図 5 に記載の照明光学ユニット 4 の方式で偏向ファセットミラー 21 と瞳ファセットミラー 25 とを含む図 6 に記載の照明光学ユニット 32 の変形を示している。

【0087】

図 9 は、視野ファセットミラー 19 が、照明光 16 を瞳ファセットミラー中立区画 34 に案内するように傾斜された照明状況を示している。

【0088】

図 10 は、瞳ファセットミラー 19' が、瞳ファセットミラー 25 の偏光区画 29、30 が偏向ファセットミラー 21 によって作動される傾斜位置に変位した照明状況を示している。この場合にそれによって図 4 及び図 5 に関して、更に図 6 の視野ファセットミラー 19 の傾斜変形に関して上述した照明変形がもたらされる。

【0089】

図 9 に記載の照明状況では、最大照明角度に至るまでの照明角度による非偏光作動を達成することが可能である。図 10 に記載の照明状況では、絶対値で大きい照明角度による偏光作動で物体視野 5 の照明を達成することが可能である。

【0090】

照明光学ユニット 32 の変形は、偏光の向きを予め定めるために及び / 又は物体視野 5 上での視野ファセット 20 の像の向きを予め定めるために、ここでもまた偏向ファセットミラー 21、瞳ファセットミラー 25、及び任意的に視野ファセットミラー 19 をピボット可能方式でピボット回転させることができるように具現化することができる。この目的をもたらすために、ファセットミラー 21、25、及び任意的に 19 は、図 6 から図 10 にはそれ以上詳細には描示していないピボットドライブと相互作用を行うことができる。

【0091】

以下に続く本文では、図 1 1 から図 1 3 に基づいて、投影露光装置 1 内で照明光学ユニット 4 又は 4 9 の代わりに使用することができる照明光学ユニットの更に別の実施形態 6 1 を説明する。図 1 から図 1 0 を参照して上述したものに対応する構成要素及び機能は同じ参照符号を伴い、これらに対して下記で再度詳細に解説することはしない。

【0092】

照明光学ユニット 6 1 では、瞳ファセットミラー 2 5 の中立区画 3 4 に中心通路開口部 6 2 が設けられる。中心通路開口部 6 2 は、瞳ファセットミラー 2 5 の偏光区画 2 9、3 0 とは別々の偏光区画として具現化される更に別の偏光区画 6 3 の通過に向けて具現化される。更に別の偏光区画 6 3 の指形状支持体 6 4 は、変位アクチュエータ 6 5 を用いて中立区画 3 4 の平面に対して垂直な変位方向に沿って変位可能であるように具現化される。

【0093】

図 1 1 は、無効位置にある瞳ファセットミラー 2 5 の更に別の偏光区画 6 3 を示している。図 1 1 に記載の瞳ファセットミラー 2 5 は、この場合に、原理的に図 1 から図 5、図 9、及び図 1 0 を参照して上述したように作動する。この場合に、中立区画 3 4 によって照明光 1 6 を反射することができないのは通路開口部 6 2 の領域内だけである。

【0094】

図 1 2 及び図 1 3 は、更に別の中心偏光区画 6 3 の有効位置にある図 1 1 に記載の瞳ファセットミラー 2 5 を示している。この目的をもたらすために、更に別の偏光区画 6 3 は、約 45° だけ傾斜したその反射面が偏向ファセットミラー 2 1 と共に z 方向に静止レベル (rest level) に来るように、変位アクチュエータ 6 5 によって中立区画 3 4 の通路開口部 6 2 を通して移動される。同時に、更に別の瞳ファセットミラー 2 5、すなわち、中立区画 3 4 及びそれに続いて形成された偏光区画 2 9、3 0 は、反対方向、すなわち、図 1 2 の負の z 方向に変位し、従って、照明ビーム経路 3 1 から出るように移動される。この変位は、中立区画 3 4 の領域内で瞳ファセットミラー 2 5 に接続された更に別の変位アクチュエータ 6 6 によって引き起こされる。

【0095】

図 1 2 及び図 1 3 に記載の配置では、照明ビーム経路 3 1 内の照明光 1 6 は、それが偏光区画 6 3 上での反射の後に直線で、図 1 2 に記載の作図面に対して垂直な偏光状態にあるように、この場合に約 43° の入射角、すなわち、ブリュースター入射角で偏光区画 6 3 の反射面によって偏向される。

【0096】

平面実施形態を有する偏光区画 6 3 に対する代替として、偏光区画 2 9、3 0、及び 5 1 に関して上述したように、半円形偏向ファセットミラー 2 1 の作動により、横円錐形偏光区画 6 3 での反射によって前と同じく異なる偏光方向を有する直線偏光光を生成することができるように、偏光区画 6 3 を、例えば偏光区画 2 9 に対応する凸横円錐区画の形態で形成することができる。

【0097】

中心偏光区画 6 3 にわたる図 1 2 及び図 1 3 に記載のビーム案内は、好ましくは、位相マスクと共に使用することができる。更に別の用途は、投影光学ユニット内での偏光区画 6 3 と共役な掩蔽との併用によるレチクル 7 の暗視野照明にある。この場合に、レチクル 7 の構造において回折された照明光 1 6 のみがウェーハ 1 3 を照明することに寄与する。

【0098】

図 1 1 から図 1 3 に記載の瞳ファセットミラー 2 5 では、中立区画 3 4 は、中心偏光区画 6 3 の周りに少なくとも部分円の形状で配置され、描示する例示的实施形態において、更に完全円として配置される。

【0099】

図 1 1 から図 1 3 に記載の瞳ファセットミラー 2 5 は、互いに別々の 2 つの偏光区画を有し、すなわち、第 1 に中心偏光区画 6 3 及び第 2 に相互接続した偏光区画 2 9、3 0 を有する。図 1 1 から図 1 3 に記載の実施形態に関して例示的に記載されているように、瞳ファセットミラーの異なる別々の偏光区画は、互いに対して及び / 又は瞳ファセットミラ

ーの少なくとも1つの中立区画に対して変位可能にすることができる。

【0100】

複数は他に多数の偏向ファセット22を視野ファセット20の各々に割り当てることができる。その結果、物体視野5に結像される視野ファセット20のうちの1つから発する照明光部分ビームを視野ファセットミラー19の適切にグループ分けされた個々のミラー又はマイクロミラーを用いて、複数の瞳ファセット28上に分散させることができる。従って、視野ファセット区画のファセット区画像は、物体視野5の物体視野高さ全体にわたって、すなわち、x広がり全体にわたって物体変位方向yに対して直角に延びる物体視野5内のストリップを構成する。従って、瞳ファセット28のうちの異なるものを通して、視野ファセット20のうちの1つの像を例えばy方向に線オフセットを有する線毎に物体視野5内に構成することができる。従って、視野ファセット20のマイクロミラーの適切な傾斜角割り当てを用いて、x方向に物体視野5全体にわたって延びる物体視野5のストリップ区画を瞳ファセットミラー25上のこの照明に係わる瞳ファセット28の位置に従う異なる照明方向から照明することができる。この照明は、例えば矩形の物体視野5の上面図1の挿入図に描示している。描示するものは、互いから破線で概略的に分離した合計で4つのそのような物体視野ストリップ5aから5dである。これらの物体視野ストリップ5aから5dは、視野ファセット20のファセット区画の像である。この挿入図には、物体視野高さ、すなわち、物体視野5のx方向の広がり全体を 5_x で表している。この場合に、y方向に沿って物体視野5を通して走査されるレチクル点は、走査積分方式で、様々な照明方向からの照明光を捉える。

【0101】

図14は、物体視野5の四重極照明を生成するための偏向ファセットミラー21及び瞳ファセットミラー25の実施形態を図3及び図11と類似の図に示している。四重極照明では、各物体視野点は、照明瞳の四分円のうちの1つの中に各々が配置された4つの照明極によって照明される。四分円の各々では、照明光16の直線偏光36は、それぞれの四分円の中心と照明瞳の中心の間の接続線に対して垂直な偏光方向を有する。

【0102】

図14では、四重極照明に向けて瞳ファセットミラー25が照明される4つの四分円を数学の慣例通りにI、II、III、及びIVで付番している。瞳ファセットミラー25の四分円I及びIII内には、xy角二等分線と平行な直線偏光方向36が存在する。2つの他の四分円II及びIV内の直線偏光36は、このxy角二等分線に対して厳密に垂直に延びている。

【0103】

図14の偏向ファセットミラー21上の網掛け付きの偏向ファセット領域66a内にある偏向ファセットミラー21の偏向ファセット22は、瞳ファセットミラー25の適切な照明に寄与する。

【0104】

図1に関して上述したように、2つのファセットミラー21、25は、ピボット軸48aの周りにピボット可能であるように具現化することができる。その結果、四重極照明の偏光方向及び四重極照明の極の向きを予め定められた値に適応させることができる。偏向ファセットミラー21が瞳ファセットミラー25と共に実行するピボット回転移動を図14に双方向矢印67に示している。偏向ファセットミラー21及び瞳ファセットミラー25に対して、共通ピボットドライブ48bによる $\pm 45^\circ$ の範囲のピボット軸48aの周りのピボット回転を予め定めることができる。全体としての視野ファセットミラー19のピボット回転により、又は視野ファセット20のマイクロミラー実施形態の場合は適合される視野ファセットへのマイクロミラー群の割り当てを変更することにより、関係する視野ファセットミラー19の視野ファセット20のアラインメントをもたらすことができる。

【0105】

投影露光において、レチクル7と、EUV放射線ビーム16に対する感光コーティング

を有するウェーハ 13 とが与えられる。露光の前に、照明設定、すなわち、例えば二重極設定又は環状設定、又は他に異なる設定、例えば従来照明設定又は多重極照明設定が設定される。次いで、投影露光装置 1 を用いてレチクル 7 の少なくとも 1 つの区画がウェーハ 13 上に投影される。最後に、EUV 放射線ビーム 16 に露光されたウェーハ 13 上の感光層が現像される。このようにして、微細構造化又はナノ構造化構成要素、例えば、半導体構成要素、例えば、マイクロチップが生成される。

【符号の説明】

【0106】

1 投影露光装置

4 照明光学ユニット

10 投影光学ユニット

19 視野ファセットミラー

34 瞳ファセットミラー中立区画

【誤訳訂正 2】

【訂正対象書類名】特許請求の範囲

【訂正対象項目名】全文

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

結像される物体 (7) を配置することができる物体視野 (5) を照明光 (16) で照明するための投影リソグラフィのための照明光学ユニット (4; 49; 61) であって、

複数の視野ファセット (20) を有する視野ファセットミラー (19) を有し、

複数の瞳ファセット (28) を有する少なくとも 1 つの瞳ファセットミラー (25) を有し、

前記視野ファセット (20) は、伝達光学ユニット (21, 25, 39) によって前記物体視野 (5) 内に結像され、

瞳ファセットミラー偏光区画に入射する光は、その偏光状態をそのような瞳ファセットミラー偏光区画によって変更され、

瞳ファセットミラー中立区画に入射する光は、その偏光状態をそのような瞳ファセットミラー中立区画によって変更されず、

少なくとも 1 つの前記瞳ファセットミラー偏光区画 (29, 30; 51; 29, 30, 63) を有し、これが、前記照明光 (16) の部分ビームを案内するように位置合わせされた、前記視野ファセット (20) のうちの 1 つと、前記瞳ファセット (28) のうちの 1 つとによってそれぞれ形成される照明チャネルに沿う該照明光 (16) の照明ビーム経路 (31) の入射角が、該瞳ファセットミラー偏光区画 (29, 30; 51; 29, 30, 63) の該瞳ファセット (28) 上の多層反射コーティングのプリユスター角から最大で 20° だけ該瞳ファセットミラー偏光区画 (29, 30; 51; 29, 30, 63) の該瞳ファセット (28) においてずれるように配置され、

少なくとも 1 つの前記瞳ファセットミラー中立区画 (34; 52) を有し、これが、前記照明光 (16) の部分ビームを案内するように位置合わせされた、前記視野ファセット (20) のうちの 1 つと、前記瞳ファセット (28) のうちの 1 つとによってそれぞれ形成される照明チャネルに沿う該照明光 (16) の照明ビーム経路 (37) の入射角が、該瞳ファセットミラー中立区画 (34; 52) の該瞳ファセット (28) 上への法線入射から最大で 20° だけ該瞳ファセットミラー中立区画 (34; 52) の該瞳ファセット (28) においてずれるように配置される、

ことを特徴とする照明光学ユニット (4; 49; 61)。

【請求項 2】

前記視野ファセットミラー (19) は、視野ファセット (20) の傾斜位置に基づいて前記瞳ファセットミラー偏光区画 (29, 30; 51; 29, 30, 63) と前記瞳ファ

セットミラー中立区画（３４；５２）とが前記照明光（１６）によって入射を交互に受けることができるように傾斜させることができる視野ファセット（２０）を用いて具現化されることを特徴とする請求項１に記載の照明光学ユニット。

【請求項３】

前記視野ファセットミラー（１９）は、該視野ファセットミラー（１９）の傾斜位置に基づいて前記瞳ファセットミラー偏光区画（２９，３０；５１；２９，３０，６３）と前記瞳ファセットミラー中立区画（３４；５２）とが前記照明光（１６）による入射を交互に受けることができるように全体的に傾斜させることができるように具現化されることを特徴とする請求項１に記載の照明光学ユニット。

【請求項４】

前記瞳ファセットミラー中立区画（３４）に対する前記照明ビーム経路（３７）の中心主光線（４０）の案内が、前記少なくとも１つの瞳ファセットミラー偏光区画（２９，３０）に対する前記照明ビーム経路（３１）の中心主光線（４１）の案内平面（４２）を少なくとも区画的に外れて位置し、該案内平面（４２）は、前記視野ファセットミラー（１９）の反射面の中心（４３）と、前記瞳ファセットミラー（２５）の反射面の中心（３２a）と、中心物体視野点（４４）とによって定められることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の照明光学ユニット。

【請求項５】

前記瞳ファセットミラー偏光区画（２９，３０；５１；２９，３０，６３）と前記瞳ファセットミラー中立区画（３４；５２）は、１つのかつ同じ瞳ファセットミラー（２５）の区画であることを特徴とする請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の照明光学ユニット。

【請求項６】

前記瞳ファセットミラー偏光区画（２９，３０）のうちの少なくとも１つが、前記瞳ファセットミラー中立区画（３４）の周りに少なくとも部分円の形態に配置されることを特徴とする請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の照明光学ユニット。

【請求項７】

前記瞳ファセットミラー中立区画（３４）のうちの少なくとも１つが、前記瞳ファセットミラー偏光区画（６３）の周りに少なくとも部分円の形態に配置されることを特徴とする請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の照明光学ユニット。

【請求項８】

前記瞳ファセットミラー偏光区画（５１；６３）又は前記瞳ファセットミラー中立区画（３４）は、前記視野ファセットミラー（１９）と前記物体視野（５）の間で前記照明光（１６）の前記ビーム経路から変位させることができることを特徴とする請求項１から請求項７のいずれか１項に記載の照明光学ユニット。

【請求項９】

互いに別々である少なくとも２つの瞳ファセットミラー偏光区画（２９，６３；３０，６３）を特徴とする請求項１から請求項８のいずれか１項に記載の照明光学ユニット。

【請求項１０】

請求項１から請求項９のいずれか１項に記載の照明光学ユニットと、
露光されるウェーハ（１３）を配置することができる像視野（１１）内に物体視野（５）を結像するための投影光学ユニット（１０）と、
を含むことを特徴とする光学系。

【請求項１１】

請求項１から請求項９のいずれか１項に記載の照明光学ユニットと、
ＥＵＶ光源（３）と、
を含むことを特徴とする照明系。

【請求項１２】

請求項１０に記載の光学系と、
ＥＵＶ光源（３）と、

を含むことを特徴とする投影露光装置。

【請求項 13】

構造化構成要素を生成する方法であって、
感光材料で作られた層が少なくとも部分的に付けられたウェーハ（13）を与える段階と、
結像される構造を有するレチクル（7）を与える段階と、
請求項 12 に記載の投影露光装置（1）を与える段階と、
前記投影露光装置（1）を用いて前記レチクル（7）の少なくとも一部を前記ウェーハ（13）の前記層の領域上に投影する段階と、
を含むことを特徴とする方法。